

本章目录

前言

Δ§29.1 晶体的结构和结合(补充)

§ 29.2 自由电子气体按能量的分布

§ 29.3 能带、导体和绝缘体

§ 29.4 物质导电性的能带论解释

§ 29.5 半导体的导电机构

§ 29.6 p-n结

△ § 29.7 半导体器件

§ 29.8 半导体激光器 (补充)

前言

气体 液体 固体 等离子体 液晶 固体:晶体、准晶体和非晶体

固体物理既是一门<mark>综合性的理论学科</mark>又和 <mark>实际应用紧密结合(材料、激光、半导体...)</mark>

▲ 固体物理是信息技术的物理基础

1928-29 建立能带理论并由实验证实

1947.12 发明晶体管

1962 制成集成电路

Δ§29.1 晶体的结构和结合(补充)

一. 晶体和非晶体的比较

晶体 非晶体

结 构: 规则排列的对称性 无一定规则排列

宏观性质: 多为各向异性 各向同性

熔 点: 确定 逐渐软化

二. 晶体的结构

晶体中原子规则排列形成晶格 — 具有周期性

初基晶胞一晶格的最小单元 a,b,c一晶格常数 点阵间满足关系: $\vec{r}' = \vec{r} + n_1\vec{a} + n_2\vec{b} + n_3\vec{c}$

晶格有多种类型:

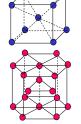
- ▲ 简单立方晶格(SC) a = b = c
- ▲ 面心立方晶格(FCC) Au , Ag ,

a = b = c Au, Ag, Cu, Al... ▲ 体心立方晶格(BCC) Li , Na , K , Fe ,

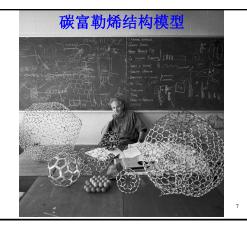
CsCl ...

▲ 六角密排晶格(HCP)

Be, Mg, Zn, Cd...



组成晶格的原子(团)在平衡点附近作热运动 (晶格振动)产生格波,声子能量 $E=(n+\frac{1}{2})hv$



三. 晶体的结合和类型

▲离子晶体 (Ionic Crystal)

正负离子交替排列形成离子键,如NaCl 晶体

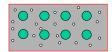
- ●离子间静电力强→熔点高,硬度好
- •无自由电子→导热导电性差
- ▲ 共价晶体 (Covalent Crystal)

如:

如: Si, Ge, 金钢石

- 强度高,坚硬, 不易变形
- 传热导电性不好

▲金属晶体(Metallic Crystal)



原子贡献出价电子为整个晶体所共有 带正电的原子实周期地排列形成晶体点阵

- 导热导电性好(有自由电子)
- 电子对原子实的排列要求不严, 展延性好

▲ 分子晶体 (Molecular Crystal) 大部分有机化合物晶体是分子晶

大部分有机化合物晶体是分子晶体 原子间的作用力是范德瓦尔斯力





吸引,能量低





排斥,能量高

•结合力小:熔点低,硬度小,易变形

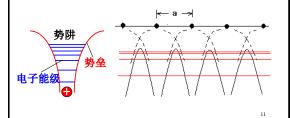
10

§ 29.2 自由电子气体按能量的分布

金属中的电子受到周期排布的晶格上离子库仑力 的作用。

孤立原子

以一维晶格为例



解定态薛定谔方程,可以得出两点重要结论:

- 1.电子的能量是量子化的:
- 2.电子的运动有隧道效应。

原子的外层电子(在高能级) 势垒穿透 概率较大,电子可以在整个固体中运动, 称为共有化电子。

原子的内层电子与原子核结合较紧,一般 不是共有化电子。

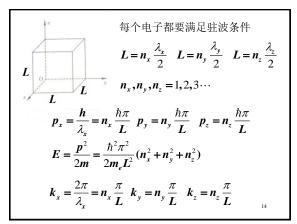
金属自由电子气体模型

平均场近似下,金属原子的价电子是在均匀的势场中运动,金属表面对电子可近似看作无限高势垒。(功函数远大于电子动能),这些价电子称为自由电子

$$U = \begin{cases} 0 & \text{内部} \\ \infty & \text{外部} \end{cases}$$

如果考虑立方体形状,N个自由电子好像是装在 三维盒子里的气体。

13



$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_e L^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

$$p_x = \hbar k_x = n_x \frac{\hbar \pi}{L}$$
 $p_y = \hbar k_y = n_y \frac{\hbar \pi}{L}$ $p_z = \hbar k_z = n_z \frac{\hbar \pi}{L}$

▶ 自由电子气体。量子化

能量、动量、波矢

- » (n_x,n_y,n_z) 量子数表示电子状态
- ▶ 相同的能量对应许多不同的状态(简并态)

(2,1,1) (1,2,1) (1,1,2)

15

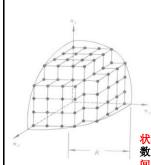
自由电子气体的能量分布

- ▶ 能量最低原则
- > 泡利不相容原理

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_e L^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \frac{2m_e L^2}{\hbar^2 \pi^2} E = R^2$$

在量子数空间, $(n_x,n_y,n_z)>0$ 第一象限内 从原点附近开始,一个球面接着一个向外填

16



在量子数空间

一个整数坐标点 对应一个状态

整数坐标点的个数 等干体积数

状态空间内整数坐标点的个 数对应其体积, 所以<mark>状态空</mark> 间内体积就是状态数目。

17

考虑自旋以后,小于能量E的状态数目

$$N_E = 2 \times \frac{1}{8} \times \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{1}{3} (2m_e)^{3/2} \frac{L^3 E^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3}$$

所有自由电子按能量从低到高占据可能的状态,

最高能量达到 E_F --费米能级 费米面

$$N = \frac{1}{3} (2m_e)^{3/2} \frac{L^3 E_F^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3} \qquad n = \frac{N}{V} = \frac{N}{L^3}$$
 自由电子数密度

$$E_F = \frac{\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{2m_e} (\frac{N}{L^3})^{2/3} = \frac{\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{2m_e} n^{2/3}$$

铜电子数密度n: $8.49 \times 10^{28} / m^3$ $E_F \sim 7eV$ $v_F = 1.6 \times 10^6 m / s$

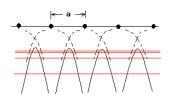
$$v_F = 1.0 \times 10 \, m/s$$

 $E_F = \frac{p_F^2}{2m_e} = \frac{1}{2} m_e v_F^2$ p_F, v_F 费米动量和费米速率

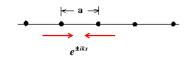
§ 29.3 能带、导体和绝缘体

一、能带

自由电子近似过于简单 要考虑与晶格散射



19



布拉格衍射极大条件 $2d\sin\theta = n\lambda n$ 整数

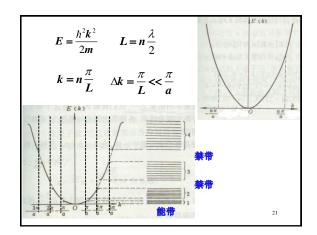
对于一维
$$\theta = \frac{\pi}{2}$$
 $2d = n\lambda$

$$\lambda = \frac{2a}{n} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} = n\frac{\pi}{a}$$

对应的能量
$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (\frac{\pi}{a})^2 n^2$$

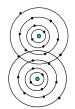
这种能量的电子不能自由传播

20



相互作用使原子能级发生分裂(简并解除)

两个原子(分子)的情况

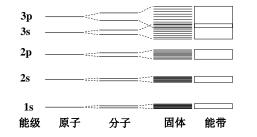


1c — — —

泡利不相容原理,原来的一条能级分裂为两条。

2

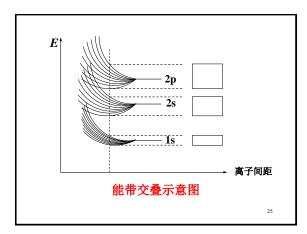
相互作用使原子能级发生分裂(简并解除) 从原子能级到固体能带(N个原子情况)



原子之间的相互作用使孤立原子的能级分裂(简并解除)。设有N个原子,形成固体后,原来孤立原子的1个能级,分裂成N条靠得很近的能级,称为<mark>能带</mark>。

能带宽度 $\Delta E \sim eV$,带内能级间距 $\sim \Delta E/N$

- 一般规律:
- 越是外层电子, 带宽 ΔE 越大
- 点阵间距越小, 带宽 ΔE 越大
- 能带之间有可能交叠



二、能带中电子的排布

固体中的一个电子只能处在某个能带中的 某一能级上排布原则(与单原子相同):

- (1) 服从泡利不相容原理(费米子)
- (2) 服从能量最小原理

设孤立原子的一个能级 E_{nl} ,最多能容纳2(2l+1)的电子,这一能级分裂成由N条能级(N个原子)组成的能带,最多能容纳2N(2l+1)个电子。例如

1s, 2s能带, 最多容纳2N个电子。

2p, 3p能带,最多容纳6N个电子。

26

基本概念

满带、不满带:填满或未填满电子的能带

空带: 未填电子的能带

禁带: 不允许填充电子的能量区

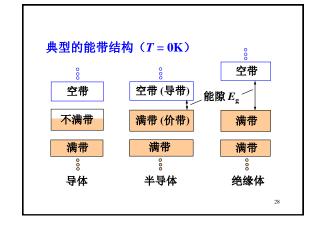
价带:和价电子能级相应的能带,即最高的

填有电子的能带

(半导体的价带通常是满带)

导带: 往上紧邻价带的未排电子的能带

27

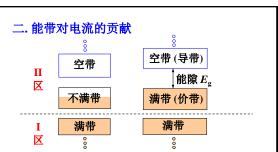


§ 29.4 物质导电性的能带论解释

一. 电流形成

经典解释:在电场作用下,电子获得能量作 集体的定向运动,形成电流。

量子解释:在电场作用下,电子发生带内或 带间量子跃迁,使能带填充非对称化,带内 电子对电流贡献不能抵消,导致电流形成。



 I区的满带在电场作用下仍保持满带以及对称化填充, 带内不同能态的电子对电流的贡献相互抵消,故满带 不导电。

 II 区的不满带和满带对应价电子,在适当的外电场 作用下,可以产生带内量子跃迁或跃向邻近空带的 带间量子跃迁,导致:

这些能带变成<mark>非对称化填充的不满带,</mark>带内电子对 电流贡献不能抵消,形成导电性。

三. 导体、半导体、绝缘体

导体

存在不满带,带内的能级近似连续,所以不用很强的 外电场,就可产生大量带内量子跃迁,造成非对称化填 充的不满带,形成导电性。

半导体:

 $\frac{Fc + v + v}{Fc + v}$ (纯净半导体约 $0.1 \sim 2eV$),施加一定强度的外电场,就可产生价带到导带的量子跃迁,造成非对称化填充的不满带,形成导电性。

绝缘休.

存在较大的能<mark>隙</mark>(3~6eV),施加一般强度的外电场 无法产生满带到空带的量子跃迁,很难形成导电性。

§ 29.5 半导体的导电机构

一. 本征半导体

本征半导体是无杂质的纯净半导体。





电子和空穴叫本征载流子,总是成对出现, 形成半导体的本征导电性。

34

本征光电导

【例】半导体 Cd S能隙 2.42eV,要产生本征 光电导,激发电子的光的波长最大值多少?

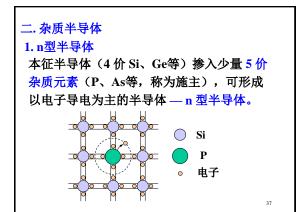
$$\mathbf{F}: h \mathbf{v} > E_g \quad \Rightarrow \quad \lambda < h c / E_g$$

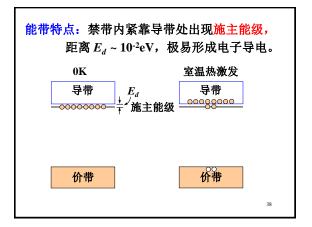
$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{E_g} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{2.42 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 514 \text{nm}$$

半导体的两种导电机制

- 电子导电 主要载流子是电子
- 空穴导电 主要载流子是空穴

【思考】为何导体电阻随温度升高而升高, 半导体电阻却随温度升高而降低?





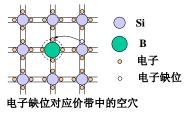
Si浓度~10²⁸ m⁻³, P浓度~10²⁴ m⁻³, Si / P~10⁴

室温下	本征激发	杂质激发	总计
载流子浓度	111111111111111111111111111111111111111	31/2002	,5.7,
价带空穴	~ 10 ¹⁶ m ⁻³		
浓度 n _p			
导带电子	~ 10 ¹⁶ m ⁻³	~ 10 ²⁴ m ⁻³	~ 10 ²⁴ m ⁻³
浓度 n _n	~ 10 · III ·	~ 10 III ·	~ 10 III ·

对 \mathbf{n} 型半导体: 电子浓度 $n_n \approx$ 施主浓度 n_d ,电子是多数载流子,空穴是少数载流子。

2. p型半导体

本征半导体(4 价 Si、Ge等)掺入少量 3 价 杂质元素(B、Ga等,称为受主),可形成 以空穴导电为主的半导体— p型半导体。

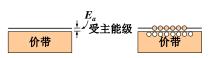


能带特点: 禁带内紧靠价带处出现受主能级, 距离 $E_a < 10^{-1} \mathrm{eV}$,极易形成空穴导电。

> 0K 导带

室温热激发

导带 。



Si浓度~10²⁸ m⁻³,B浓度~10²⁴ m⁻³,Si / B~10⁴

室温下 载流子浓度	本征激发	杂质激发	总计
价带空穴 浓度 n _p	~ 10 ¹⁶ m ⁻³	~ 10 ²⁴ m ⁻³	~ 10 ²⁴ m ⁻³
导带电子 浓度 n _n	~ 10 ¹⁶ m ⁻³		

对 p 型半导体: 空穴浓度 $n_p \approx$ 受主浓度 n_a , 空穴是多数载流子,电子是少数载流子。

3. 化合物半导体

- 半导体GaAs中掺Te,6价的Te替代5价的As产生施主能级,成为n型杂质半导体。
- 半导体GaAs中掺Zn, 2价的Zn替代3价的 Ga产生受主能级,成为p型杂质半导体。

43

三. 杂质的补偿作用

实际半导体中,既有施主杂质(浓度 n_a), 又有受主杂质(浓度 n_a),两种杂质产生 补偿作用:

> 若 $n_d > n_a$ — 为n型(施主) 若 $n_d < n_a$ — 为p型(受主)

利用杂质的补偿作用可制成 p-n 结。

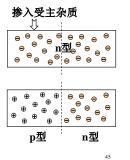
44

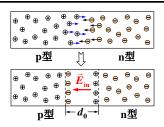
§ 29.6 p-n 结

一. p-n 结的形成

n型半导体一侧掺入 较高浓度的受主杂质

由于杂质的补偿作用, 该区成为 p型半导体





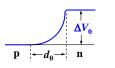
界面附近,多数载流子扩散,产生内建电场 $E_{\rm in}$, $E_{\rm in}$ 增大并阻止多数载流子进一步扩散,帮助少数载流子反向漂移,扩散和漂移平衡后形成 p-n结(耗尽层),厚度 $d_0 \sim 0.1 \mu m$ 。

二. 能带弯曲

与内建电场相应,p-n结处存在电势差 ΔV_0 ,形成势垒区,对电子产生附加势能。

电势分布曲线

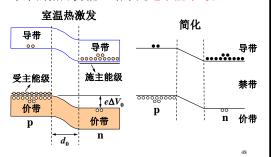
电子电势能曲线





47

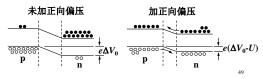
当存在p-n结时,电子的能量需要考虑势垒带来的附加势能,结果是电子能带弯曲:



三.p-n结的伏安特性 1. 正向偏压

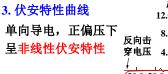
p型接正极,n型接负极

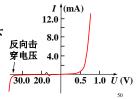
正向偏压使耗尽层势垒降低变窄,有利于 电子向p区运动,空穴向n区运动,形成 正向电流(mA量级)。



2. 反向偏压

p型接负极,n型接正极 反向偏压使耗尽层势垒增高变宽, 不利于 电子向p区及空穴向n区运动,但少数载流 子可形成很弱的反向漏电流(µA量级)。





△ § 29.7 半导体器件(自学)

1947年12月23日,美国贝尔实验室诞生世界 上第一只具有放大作用的晶体三极管。

1956年三位成员获诺贝尔物理学奖







W.H.Brattain J.Bardeen

W.Shockley

51

§ 29.8 半导体激光器 (补充)

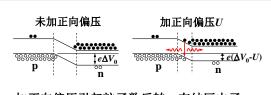
半导体激光器分两类:

同质结激光器 — 由同种材料制成的p-n结

异质结激光器 — 由两种不同材料制成的

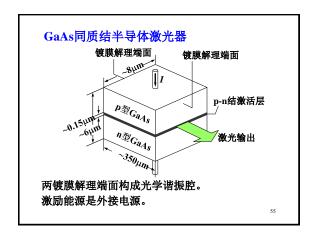
p-I-n结(I为本征半导体)

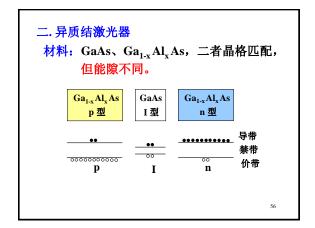
一. 同质结激光器 普通掺杂 р 价带 导带 重掺杂 价带 53

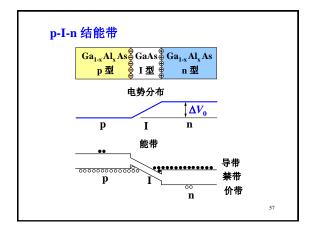


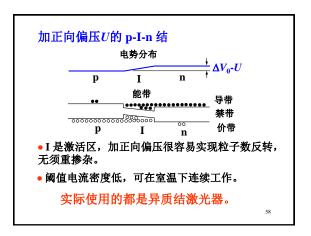
加正向偏压引起粒子数反转,在结区电子 空穴复合发光,由自发辐射引起受激辐射。

同质结缺点是需要重掺杂,且光损耗大。









半导体激光器的特点

体积小 极易与光纤接合 所需电压低 对GaAs只需1.5V 效率高 电能直接变成光能 功率可达 10²mW 寿命长 可达百万小时 制造方便成本低

59

中英文名称对照表

能带 — energy band

能隙 — energy gap

价带、导带 — valence band、 conduction band

导体 — conductor

半导体 — semiconductor

绝缘体 — insulator

空穴 — hole

杂质 — impurity

施主、受主 — donor、acceptor

